(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2009 年2 月5 日 (05.02.2009)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2009/017088 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/683 (2006.01) *H02N 13/00* (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2008/063511

(22) 国際出願日: 2008 年7 月28 日 (28.07.2008)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2007-201579 2007 年8 月2 日 (02.08.2007) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社アルバック (ULVAC, INC.) [JP/JP]; 〒2538543 神奈川県茅ヶ崎市萩園２５００番地 Kanagawa (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 藤井 佳詞 (FUJII, Yoshinori) [JP/JP]; 〒4101231 静岡県裾野市須山１２２０－１４ 株式会社アルバック 富士裾野工場内 Shizuoka (JP). 中野 賢明 (NAKANO, Katsuaki) [JP/JP]; 〒4101231 静岡県裾野市須山１２２０－１４ 株式会社アルバック 富士裾野工場内 Shizuoka (JP). 福本 英範 (FUKUMOTO, Hidenori) [JP/JP]; 〒4101231 静岡県裾野市須山１２２０－１４ 株式会社アルバック 富士裾野工場内 Shizuoka (JP). 宮永 信正 (MIYANAGA, Nobumasa) [JP/JP]; 〒4101231 静岡県裾野市須山１２２０－１４ 株式会社アルバック 富士裾野工場内 Shizuoka (JP).

(74) 代理人: 特許業務法人エクシオ (Exeo Patent & Trademark Company); 〒1500022 東京都渋谷区恵比寿南３－１－１９ 恵比寿ライトビル２階 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

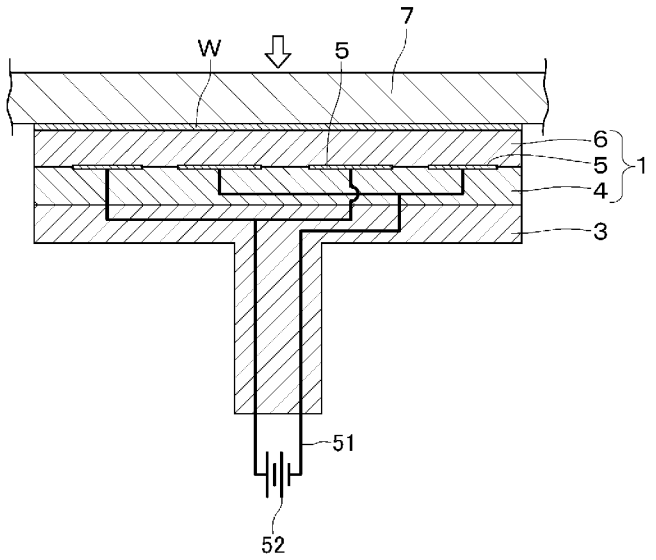
(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD,

[続葉有]

(54) **Title:** METHOD OF MANUFACTURING ELECTROSTATIC CHUCK MECHANISM

(54) **発明の名称:** 静電チャック機構の製造方法

[図3]



(57) **Abstract:** A method of manufacturing an electrostatic chuck. The chuck has a dielectric layer that comes into contact with an object to be held by the chuck and is made of silicone rubber or a resin. When manufactured, the dielectric layer is not affected by impurities remaining on the surface of or inside the dielectric layer, so that the performance of the dielectric layer does not vary or the separation of the dielectric layer does not occur from the beginning of the use of the chuck. The method has a step of pressing a heating plate (7), heated to a predetermined temperature, against a contact surface of the dielectric layer (6) before or after the dielectric layer (6) is installed on the surface of a substrate (3) where electrodes (5) are arranged.

[続葉有]

WO 2009/017088 A1

SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

(57) 要約: 被チャック物を保持するときに当該被チャック物と接触する誘電層を、シリコーンゴムや樹脂から作製した場合、その作製時に表面或いは内部に残留した不純物の影響を受けずに、使用当初から性能のばらつきや脱離不良が生じることのない静電チャックの製造方法を提供する。誘電層(６)を、電極(５)を設けた基材(３)表面に組付ける前または当該基材(３)表面に組付けた後、前記誘電層(６)の接触面に、所定温度に加熱した加熱板(７)を押し付ける工程を実施する。